

ナノ構造造形・観察支援実施における研究成果の取扱いに関する方針

平成 20 年 10 月 24 日制定

令和 4 年 3 月 18 日改正

研究・産学連携本部

(目的)

第 1 条 本方針は、本学が、文部科学省の事業である「先端施設供用イノベーション創出事業ナノテクノロジーネットワークプログラムに基づく電子ビームによるナノ構造造形・観察支援」(平成 19 年～平成 23 年度)、「ナノテクノロジープラットフォーム」(平成 24 年度～令和 3 年度)及び「マテリアル先端リサーチインフラ事業」(令和 4 年度～令和 12 年度(予定))に基づき、本学の研究上の支援を受ける者(以下「被支援者」という。)に対し、被支援者が指定し、又は被支援者が本学に提供する試料について、被支援者に代り、本学の保有する電子ビーム露光装置、成膜装置、エッチング装置等のナノ構造作製装置及び電子顕微鏡その他の機器又は装置(以下「機器等」という。)を使用して、その構造を作製・観察し、又は被支援者が、その用意する試料について、被支援者が、自ら機器等を使用して、その構造を作製・観察するに際して生ずる研究成果の取扱いを定める。なお、試料の作製・観察が、本学と被支援者の共同研究によるときは、本学所定の共同研究契約の定めるところによる。以下において、試料の作製・観察を「本作製・観察」という。

(定義)

第 2 条 本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 発明等 本作製・観察の過程において、又は本作製・観察の結果として得られた発明、考案、意匠、商標及び回路配置をいう。
- (2) 特許等 発明等に関する特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録及び回路配置利用権の設定登録(外国におけるこれらの制度に相当するものを含む。)をいう。
- (3) 特許等を受ける権利 発明等に関する特許等を受ける権利(外国において特許等を受ける権利を含む。)をいう。
- (4) 特許権等 発明等に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び回路配置利用権(外国におけるこれらの権利に相当するものを含む。)をいう。
- (5) プログラム等著作権 本作製・観察の過程において、又は本作製・観察の結果として得られたプログラム及びデータベースの著作権(外国におけるこれらの権利に相当するものを含む。)をいう。
- (6) ノウハウ 本作製・観察の過程において、又は本作製・観察の結果として得られた

営業秘密その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であつて、秘密として管理され、かつ、公然と知られていないものをいう。

- (7) 研究成果 発明等、特許等を受ける権利、特許権等、プログラム等著作権、ノウハウ及び本共同研究の過程において、又は結果として得られた有体物をいう。

(研究成果の帰属)

第3条 本学は、被支援者に代り、本作製・観察を行う場合において、本学の研究者が研究成果を得たときは、当該研究者から当該研究成果に関する権利を取得する。ただし、当該研究者の得た研究成果中のプログラム等に関する著作権であつて、本学の規則により職務著作とされないものについては、この限りでない。

- 2 本学は、自己の研究者が研究成果を得た場合において、当該研究者から当該研究成果に関する権利を取得したときは、これを被支援者に通知し、かつ、次項の規定に従い、当該研究成果の帰属を決定する。
- 3 本学の研究者又は被支援者の研究者が単独で得た研究成果は、それぞれ本学又は被支援者の単独所有とし、また、本学の研究者及び被支援者の研究者が共同して得た研究成果は、本学及び被支援者の共有とする。

(研究成果の譲渡)

第4条 前条第3項の規定により、研究成果が本学の単独所有とされた場合又は研究成果が本学と被支援者の共有とされた場合において、被支援者が希望するときは、本学は、当該研究成果又はその持分を権利放棄する。

(直接使用)

第5条 前2条の規定は、被支援者が、自ら直接機器等を使用して、自己の用意する試料の構造を観察するに際して生ずる研究成果の取扱いの場合に準用する。

(特許等の出願)

- 第6条 本学及び被支援者は、本学の研究者又は被支援者の研究者が単独で得た発明等に関し、特許等の出願をし、特許権等を維持しようとするときは、それぞれ単独で、当該特許等の出願及び特許権等の維持のための手続を行う。この場合、本学及び被支援者は、それぞれ当該特許等の出願及び特許権等の維持に要する費用を負担する。
- ただし、本学又は被支援者は、当該発明等に関する特許等を受ける権利を相手方から承継したときは、自己の費用負担において単独で特許等の出願を行う。
- 2 本学及び被支援者は、本学の研究者及び被支援者の研究者が共同して得た発明等に関し、特許等の出願をし、特許権等を維持しようとするときは、本学及び被支援者が共同して、当該特許等の出願及び特許権等の維持のための手続を行う。この場合、本学及び被支援

者は、本学と被支援者との間において別に締結する特許等の共同出願に関する契約において、特許等を受ける権利及び特許権等に対する持分の割合、特許等の出願及び特許権等の維持に要する費用の負担その他当該発明等の取扱いに関する事項を定める。

ただし、本学又は被支援者は、当該発明等に関する特許等を受ける権利を相手方から承継したときは、自己の費用負担において単独で特許等の出願を行う。

- 3 前項に規定する発明等に関する外国における特許等の出願及び特許権等の維持の要否については、本学及び被支援者が協議の上、これを決定する。

(研究成果の利用)

第 7 条 前条第 1 項（本学が単独で所有するものに限る）及び第 2 項に規定する発明等の利用については、本学及び被支援者が協議の上、これを決定する。

(本方針の適用)

第 8 条 本方針は、平成 20 年 10 月 24 日から適用する。

改訂履歴

	年月日	内 容
制定	H20.10.24	
改訂 1	H28.2.26	本方針の対象に「ナノテクノロジープラットフォーム」を追加
改訂 2	H29.4.1	組織改編に伴う、組織名称修正
改訂 3	R3.6.16	第 4 条及び第 7 条文言修正
改定 4	R4.3.18	本方針の対象に「マテリアル先端リサーチインフラ事業」を追加